Лауэ-дифракция рентгеновских пучков в многослойной структуре

Д.В. Казаков, В.И. Пунегов

Физико-математический институт ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, г. Сыктывкар

kazakov@pmi.komisc.ru vpunegov@pmi.komisc.ru

Аннотация

Разработана теория Лауэ-дифракции рентгеновских микропучков в мультислоях (МС). Получено решение для вычисления рентгеновских карт в обратном пространстве. Показан маятниковый эффект (Pendellösung effect) для совершенного и несовершенного МС. Выполнено численное моделирование Лауэ-дифракции в мультислое Mo/Si с граничными условиями в случае геометрической оптики и приближения Френеля. Показано, что при работе с рентгеновскими микропучками необходимо учитывать эффекты дифракции рентгеновских волн на краях щелей и коллиматоров исследовательской установки.

Ключевые слова:

Лауэ-дифракция, рентгеновские пучки, маятниковый эффект, многослойные структуры

Введение

Многослойные структуры (МС) применяются в установках синхротронного излучения для транспортировки рентгеновских пучков, фокусирования излучения, при экстремальной ультрафиолетовой литографии (EUVL) и в астрономии. Преимущественно МС выполняют функции отражателей скользящего рентгеновского излучения. Для фокусировки жестких рентгеновских лучей предложено создать многослойные Лауэ линзы [1]. Теоретические основы рентгеновской дифракции такими линзами описаны в [2]. Изготовление многослойных Лауэ линз представляет собой сложную задачу, и первым шагом в этом направлении является изучение Лауэ-дифракции в МС с постоянным периодом [3]. Поэтому в данной работе рассмотрена теория Лауэ-дифракции рентгеновских микропучков в МС с использованием формализма для пространственно-ограниченных рентгеновских полей [4,5].

1. Динамическая Лауэ-дифракция ограниченных рентгеновских пучков в мультислое

Рассмотрим динамическую Лауэ-дифракцию рентгеновских лучей в секционированном мультислое с постоянным периодом *d* (рис. 1). Введем декартову систему координат: ось *z* направим вдоль облучаемой поверхности MC, а

Laue diffraction of X-ray beams in a multilayer structure

D.V. Kazakov, V.I. Punegov

Institute of Physics and Mathematics, Federal Research Centre Komi Science Centre, Ural Branch, RAS, Syktyvkar kazakov@pmi.komisc.ru

vpunegov@pmi.komisc.ru

Abstract

The Laue diffraction theory of X-ray microbeams in multilayers (MLs) has been developed. The solution for calculating Xray reciprocal space maps has been obtained. The pendulum (Pendellösung) effect for perfect and imperfect MLs has been demonstrated. The numerical simulation of Laue diffraction in Mo/Si multilayers with boundary conditions in the case of geometrical optics and the Fresnel approximation has been carried out. For X-ray microbeams, the scattering at the edges of collimators and slits of the diffractometer should be taken into account.

Keywords:

Laue diffraction, X-ray beams, Pendellösung effect, multilayer structures

ось x — нормально к ней. На пути распространения исходной плоской волны на расстоянии L_{S1} от поверхности МС расположен пространственный ограничитель S_1 (коллиматор, щель), который выделяет микропучок шириной w_1 , падающий на поверхность МС под углом $\theta=\theta_B+\omega$, где ω — малый угол отклонения. Амплитуду излучения на входной поверхности обозначим через $E_0^{(in)}$; амплитуду проходящей и дифракционной волн на выходной поверхности МС обозначим E_0 и E_1 соответственно. Дифракционная интенсивность регистрируется позиционно-чувствительным детектором (PSD), расположенным на расстоянии L_{PSD} от выходной поверхности МС.

Уравнения дифракции рентгеновских лучей в пространственно-периодических структурах [4, 5], с учетом граничных условий Лауэ-дифракции, дают решение для амплитуды дифракционного микропучка в обратном пространстве

$$E_0(q_x, q_z) = \frac{\exp(i\psi L_x)}{2\pi} \mathcal{F}_0(q_x, q_z)$$
$$E_1(q_x, q_z) = i \frac{a_1 f \exp(i\psi L_x)}{2\pi} \mathcal{F}_1(q_x, q_z)$$

$$\begin{aligned} \mathcal{F}_{0} &= \int_{-\infty}^{\infty} \left(\cos(\frac{L_{x}\xi}{2}) - i\frac{\zeta\sin(\frac{L_{x}\xi}{2})}{\xi/2} \right) \hat{Y}_{in}(\kappa) \mathrm{d}\kappa \\ \mathcal{F}_{1} &= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin(\frac{L_{x}\xi}{2})}{\xi/2} \hat{Y}_{in}(\kappa) \hat{Y}_{ex}(\kappa - qz) \mathrm{d}\kappa, \end{aligned}$$
(1)

где $\xi = -\sqrt{\zeta^2 + 4fa_1a_{-1}}$, $\zeta = q_x - (q_z - 2\kappa)\tan\theta_B$, $a_0 = \pi\chi_0/(\lambda\cos\theta_B)$, $a_1 = C\pi\chi_1/(\lambda\cos\theta_B)$, $a_{-1} = a_1$, θ_B — угол Брэгга, λ — длина волны рентгеновского излучения в вакууме, C — поляризационный фактор, f — фактор затухания, зависящий от дефектов в MC.



Рисунок 1. Схема Лауэ-дифракции в мультислое глубины L_x и толщины $L_z\colon w_{1,2}$ – поперечная ширина падающего и выходящего пучков; $L_z^{(in),(ex)}$ – проекции на ось z (направлена вдоль входной грани) поперечной ширины пучка для падающего излучения и для вышедшего из мультислоя соответственно; L_{S_1} – расстояние от щели S_1 до входной грани мультислоя (x=0); L_{PSD} – расстояние от выходной грани ($x=L_x$) до позиционно-чувствительного детектора PSD. Figure 1. Laue diffraction scheme in a multilayer structure with L_x depth and L_z thickness: $w_{1,2}$ – cross-section width of incident and output beams; $L_z^{(in),(ex)}$ – cross-section projections of incident and the output beams onto the z axis (directed along the input face), respectively, L_{S_1} – a distance between the output face ($x=L_x$) and the position-sensitive detector PSD.

Если период MC, как на рис. 1, образован бислоем вида $d = d_t + d_b$, то Фурье коэффициенты рентгеновской поляризуемости $\chi_{0,1}$ в направлении прохождения и дифракции равны

$$\chi_0 = \frac{\chi_t d_t + \chi_b d_b}{d},$$

$$\chi_1 = \frac{\chi_t - \chi_b}{\pi} \sin\left(\frac{\pi d_t}{d}\right)$$

Здесь $\chi_{t,b}$ и $d_{t,b}$ — Фурье коэффициенты поляризуемостей и толщины верхнего (t) и нижнего (b) слоев.

Распределение интенсивности рентгеновских волн в обратном пространстве при трехосевой схеме регистрации зависит от угловых положений образца ω и анализатора ε [6, 7]. В симметричной геометрии Лауэ эти углы связаны с проекциями отклонения вектора дифракции от вектора обратной решетки в горизонтальном и вертикальном

90

направлениях соотношениями $q_x = k\sin\theta_B(2\omega-\varepsilon)$ и $q_z = -k\cos\theta_B\varepsilon$. Множитель $\hat{Y}_{in}(\kappa)$ в интеграле (1) выражает граничные условия дифракционной задачи на входной поверхности МС и имеет вид

$$\hat{Y}_{in}(\kappa) = P(\kappa, L_{S_1}) \frac{\sin(\frac{\kappa}{2} L_z^{(in)})}{\frac{\kappa}{2}},$$
(2)

где $L_z^{(in)} = w_1/\cos\theta_B$ — ширина области на входной поверхности МС, засвечиваемая падающим микропучком; $P(\kappa, L_{S_1})$ — пропагатор поля рентгеновской волны в Фурье пространстве [8], который в приближении Френеля равен

$$P(\kappa, L_{S_1}) = \exp\left(-i\lambda \frac{L_{S_1}\kappa^2}{4\pi\cos^2\theta_B}\right)$$

Второй множитель

$$\hat{Y}_{ex}(\kappa - q_z) = P(\kappa - q_z, L_{PSD}) \frac{\sin\left(\frac{\kappa - q_z}{2} L_z^{(ex)}\right)}{\frac{\kappa - q_z}{2}}$$
(3)

является коэффициентом пропускания дифракционной волны в Фурье пространстве. Он зависит от ширины отраженного рентгеновского пучка $L_z^{(ex)}$ и выражается через пропагатор

$$P(\kappa - q_z, L_{PSD}) = \exp\left(-i\lambda \frac{L_{PSD}(\kappa - q_z)^2}{4\pi \cos^2 \theta_B}\right),\,$$

описывающий распространение рентгеновского излучения от выходной поверхности MC до PSD. Важно отметить, что в приближении геометрической оптики пропагаторы $P(\kappa, L_{S_1})$ и $P(\kappa - q_z, L_{PSD})$ равны единице.

Окончательное выражение для дифракционной интенсивности в обратном пространстве, регистрируемой PSD при рассеянии ограниченного фронта рентгеновской волны в MC, запишется как

$$I_1(q_x, q_z) = |E_1(q_x, q_z)|^2.$$
 (4)

Решения (1) с учетом (4) являются основными соотношениями для расчета карт рассеяния в обратном пространстве (RSM).

2. Численное моделирование

Выполним численное моделирование углового распределения интенсивности рассеяния рентгеновских лучей от MC Mo/Si. Структурные параметры MC и характеристики падающего синхротронного излучения соответствуют параметрам и условиям работы [3]. Длина волны падающего синхротронного излучения $\lambda = 0.1305$ нм, период MC $d = d_{Mo} + d_{Si} = 7$ нм, $d_{Mo} = d_{Si} = 3.5$ нм, угол Брэгга $\theta_B = 2.25$ мкрад. Оптические константы компонент MC получены с помощью онлайн сервиса рентгеновского сервера [9].

Динамическая Лауэ-дифракция рентгеновских лучей в MC сопровождается маятниковым эффектом (Pendellösung effect), когда интенсивность рентгеновского пучка проходящей волны перекачивается в дифракционный и далее, с увеличением глубины, наоборот, интенсивность дифрагированной волны передается в направление проходящего. При выполнении точного условия Брэгга выражения интенсивности для проходящей и дифракционной рентгеновских волн в MC равны

$$I_{0}(x) = e^{-\mu_{0}x} \left(\cos^{2} \left(f a_{1}^{r} x \right) + \sinh^{2} \left(f a_{1}^{i} x \right) \right),$$

$$I_{1}(x) = e^{-\mu_{0}x} \left(\sin^{2} \left(f a_{1}^{r} x \right) + \sinh^{2} \left(f a_{1}^{i} x \right) \right),$$

$$a_{1}^{r} = \frac{C \pi \chi_{1}^{r}}{\lambda \cos \theta_{B}}, a_{1}^{i} = \frac{C \pi \chi_{1}^{im}}{\lambda \cos \theta_{B}},$$
(5)

где $\mu_0 = 2\,{\rm Im}(a_0)$ — линейный коэффициент поглощения, l_{Pen} — период маятниковых осцилляций, который в симметричной геометрии Лауэ равен $l_{Pen} = \lambda \left|\cos \theta_B\right|/C/|\chi_1|$. При малых углах Брэгга $\cos \theta_B \approx 1$, период маятниковых осцилляций обратно пропорционален Фурье коэффициенту рентгеновской поляризуемости χ_1 . Для рассматриваемого MC Mo/Si и длины волны рентгеновского пучка $\lambda = 0.1305$ нм период маятниковых колебаний равен $l_P^{MOSi} = 38.2$ мкм.

На рис. 2 представлены распределения интенсивности проходящей и дифракционной волн по глубине, иллюстрирующие маятниковый эффект при соблюдении точного условия Брэгга: пунктирными линиями показаны результаты в совершенном MC с фактором затухания f = 1, а сплошными линиями — в дефектном с f = 0.8. Толщина МС составляет $L_x = 2 \, l_{Pen} = 76.4$ мкм, что соответствует двум полным периодам маятниковых осцилляций. Рис. 2 (а) показывает, что при распространении рентгеновского пучка в МС интенсивность проходящей волны перекачивается в дифракционную. На глубине x = 19.1 мкм, отвечающей половине маятникового периода, проходящая волна переходит полностью (с поправкой на фотоэлектрическое поглощение) в дифракционную, которая достигает здесь локального максимума. С дальнейшим ростом x происходит обратный процесс. Рис. 2 (b) демонстрирует влияние дефектов. И него следует, что наличие дефектов в МС ведет к увеличению периода маятниковых осцилляций и смещению взаимного положения максимумов и минимумов интенсивностей $I_0(x)$ и $I_1(x)$. Эти изменения объясняются тем, что дефекты в МС снижают отражательную способность периодической структуры. Аналогичное влияние дефектов на маятниковые осцилляции наблюдается в случае динамической Лауэ-дифракции в кристалле [10].

Зная глубину залегания максимумов и минимумов дифракционной интенсивности в МС Mo/Si, приступим к численному моделированию RSM. Расчеты выполним для МС с секционной толщиной $L_x = \operatorname{argmax}(I_1(x)) = l_P^{MoSi}/2 = 19.2$ мкм L_x , при которой интенсивность дифракционной волны достигает максимума, и с толщиной $L_x = \operatorname{argmin}(I_1(x)) = l_P^{MoSi} = 38.2$ мкм, отвечающей минимуму (рис. 2).

Результаты моделирования в рамках геометрической оптики для MC с $L_x = l_P^{MoSi}/2$ приведены на рис. 3 (а), для MC с $L_x = l_P^{MoSi}$ – на рис. 3 (b). Сравнивая между собой полученные карты, можно заметить, что для MC с секционной глубиной, равной полному периоду маятниковых осцилляций, возникает расщепление главного дифракци-



Рисунок 2. Маятниковый эффект (Pendelösung effect) в совершенном (а) и несовершенном (b) мультислое Mo/Si: кривые $I_{0,f}$, $I_{1,f}$ – проходящая и дифракционная интенсивности в несовершенном мультислое с фактором затухания f=0.8; кривые I_0 , I_1 – проходящая и дифракционная интенсивости в совершенном мультислое с фактором затухания f=1.

Figure 2. Pendelösung effect within perfect (a) and imperfect (b) Mo/Si multilayers: curves $I_{0,f}$, $I_{1,f}$ – transmission and diffraction intensities in an imperfect multilayer with damping factor f = 0.8; curves I_0 , I_1 – transmission and diffraction intensities in a perfect multilayer with damping factor f = 1.

онного пика рис. 3 (b). Данное расщепление объясняется тем фактом, что в точных условиях Брэгга $q_x=q_z=0$ на глубине $x=L_x=l_P^{MoSi}$ основная часть дифракционной интенсивности перекачивается в проходящий пучок, из-за чего на RSM вблизи точки $q_x=q_z=0$ возникает провал, но поскольку $I_1(l_P^{MoSi})$ не достигает нуля, то и значения интенсивности в окрестности данной точки не нулевые. Однако если угол падения будет отклоняться от точного условия Брэгга, то будет меняться характер распределения маятниковых осцилляций по глубине МС, в частности сократятся амплитуда и длина периода. В результате таких изменений интенсивность дифракционной волны в точке $x = l_P^{MoSi}$ не будет соответствовать положению минимума, что повлечет рост регистрируемой интенсивности. При определенных значениях угла ω может сложиться ситуация, при которой там, где при точном соблюдении условия Брэгга наблюдался минимум, расположится локальный максимум.



Рисунок 3. Карты рассеяния в обратном пространстве дифракционной интенсивности синхротронного излучения с энергией 9.5 кэВ от мультислоя Mo/Si с граничными условиями в приближении геометрической оптики: (a) – $L_x = l_P^{MoSi}/2$; (b) – $L_x = l_P^{MoSi}$. Figure 3. Calculated PSMs of diffraction intensity from a Mo/Si multilayor

Figure 3. Calculated RSMs of diffraction intensity from a Mo/Si multilayer with a synchrotron radiation energy of 9.5 keV in the case of the boundary conditions in the geometrical optics approximation: (a) $-L_x = l_P^{MoSi}/2$; (b) $-L_x = l_P^{MoSi}$.

Аналогичные расчеты выполним для пространственноограниченной рентгеновской волны с граничными условиями в приближении Френеля. Расстояние от щели до поверхности MC равно $L_{S_1} = 30$ мм, расстояние от выходной поверхности до PSD $L_P = 40$ мм, ширина падающего пучка $w_1 \approx L_z = 14$ мкм (см. рис. 1). Результаты моделирования представлены на рис. 4. Сравнивая полученные RSM с картами, представленными на рис. 3, легко заметить, что угловые распределения интенсивности рассеяния рентгеновских лучей в случае геометрической оптики и в приближении Френеля сильно отличаются. Тем не менее характерное расщепление центрального пика MC толщиной $L_x = l_P^{MoSi}$ сохранилось.

Заключение

Таким образом, мы теоретически исследовали Лауэ-дифракцию рентгеновских микропучков в секционированных мультислоях. Как в геометрии Брэгга [4], так и для случая Лауэ-дифракции микропучков при выполнении расчетов RSM всегда необходимо правильно выбирать граничные условия в приближении Френеля. Важно, что решение (1) справедливо только для мультислоев с постоянным пери-



Рисунок 4. Карты рассеяния в обратном пространстве дифракционной интенсивности синхротронного излучения с энергией 9.5 кзВ от мультислоя Mo/Si с граничными условиями в приближении Френеля: (a) – $L_x = l_P^{MoSi}/2$; (b) – $L_x = l_P^{MoSi}$; $L_{S_1} = 30$ мм и $L_P = 40$ мм. Figure 4. Calculated RSMs of diffraction intensity from a Mo/Si multilayer with a synchrotron radiation energy of 9.5 keV in the case of Fresnel boundary conditions: (a) – $L_x = l_P^{MoSi}/2$; (b) – $L_x = l_P^{MoSi}$; $L_{S_1} = 30$ mm, $L_{PSD} = 40$ mm.

одом. При исследовании апериодических многослойных структур необходимо численно интегрировать уравнения рентгеновской дифракции [2].

Литература

- Maser, J. Multilayer Laue lenses as high-resolution X-ray optics / J. Maser, G.B. Stephenson, S. Vogt, Y. Wenbing, A. Macrander [et al.] // Proceedings of SPIE. – 2004. – Vol. 5539. – P. 185–194.
- Пунегов, В.И. Влияние рассогласования толщин слоев на фокусировку рентгеновских лучей многослойными Лауэ линзами / В.И. Пунегов // Письма в ЖЭТФ. – 2020. – Т. 111. – № 7. – С. 448–454.
- Kang, H.C. High-efficiency diffractive x-ray optics from sectioned multilayers / H.C. Kang, G.B. Stephenson, C. Liu, R. Conley, A.T. Macrander [et al.] // Appl. Phys. Lett. – 2005. – Vol. 86. – P. 151109 (1–3).
- Punegov, V.I. X-ray microbeam diffraction in a crystal / V.I. Punegov, A.V. Karpov // Acta Crystallogr. A. – 2021. – Vol. 77. – P. 117–125.
- 5. Punegov, V.I. Applications of dynamical theory of X-ray diffraction by perfect crystals to reciprocal space map-

ping / V.I. Punegov, K.M. Pavlov, A.V. Karpov, N.N. Faleev // J. Appl. Crystallogr. - 2017. - Vol. 50. - P. 1256-1266.

- Пунегов, В.И. Высокоразрешающая рентгеновская дифракция в кристаллических структурах с квантовыми точками / V.I. Punegov // УФН. – 2015. – Т. 185. – № 5. – С. 449–478.
- Iida, A. Separate measurements of dynamical and kinematical X-ray diffractions from silicon crystals with a triple crystal diffractometer / A. Iida, K. Kohra, A.V. Karpov, N.N. Faleev // Physica Status Solidi (A). – 1979. – Vol. 51. – P. 533–542.
- Kohn, V.G. Theory of imaging a perfect crystal under the conditions of X-ray spherical wave dynamical diffraction / V.G. Kohn, I. Snigireva, A. Snigirev, N.N. Faleev // Physica Status Solidi (B). – 2000. – Vol. 222. – P. 407–423.
- Stepanov, S. Fitting dynamical X-ray diffraction data over the World Wide Web / S. Stepanov, R. Forrest // J. Appl. Crystallogr. – 2008. – Vol. 41. – P. 958–962.
- Пунегов, В.И. Влияние дефектов структуры на угловое распределение рентгеновской Лауэ-дифракции в тонком кристалле / В.И. Пунегов, К.М. Павлов // Письма в ЖТФ. – 1992. – Т. 18. – № 12. – С. 60–64.

References

- Maser, J. Multilayer Laue lenses as high-resolution X-ray optics / J. Maser, G.B. Stephenson, S. Vogt, Y. Wenbing, A. Macrander [et al.] // Proceedings of SPIE. - 2004. -Vol. 5539. - P. 185-194.
- Punegov, V.I. Vliyaniye rassoglasovaniya tolshchin sloyev na fokusirovku rentgenovskikh luchey mnogosloynymi Laue linzami [Effect of the mismatch of layer thicknesses on the focusing of X-rays by multilayer Laue lens] / V.I. Punegov // J. Exp. Theor. Phys. – 2020. – Vol. 111. – № 7. – P. 376–382.

- Kang, H.C. High-efficiency diffractive x-ray optics from sectioned multilayers / H.C. Kang, G.B. Stephenson, C. Liu, R. Conley, A.T. Macrander [et al.] // Appl. Phys. Lett. – 2005. – Vol. 86. – P. 151109 (1–3).
- Punegov, V.I. X-ray microbeam diffraction in a crystal / V.I. Punegov, A.V. Karpov // Acta Crystallogr. A. – 2021. – Vol. 77. – P. 117–125.
- Punegov, V.I. Applications of dynamical theory of X-ray diffraction by perfect crystals to reciprocal space mapping / V.I. Punegov, K.M. Pavlov, A.V. Karpov, N.N. Faleev // J. Appl. Crystallogr. – 2017. – Vol. 50. – P. 1256–1266.
- Punegov, V.I. Vysokorazreshayushchaya rentgenovskaya difraktsiya v kristallicheskikh strukturakh s kvantovymi tochkami [High-resolution X-ray diffraction in crystalline structures with quantum dots] / V.I. Punegov // Uspekhi fizicheskikh nauk [Advances in Physical Sciences]. – 2015. – Vol. 58. – P. 419–445.
- Iida, A. Separate measurements of dynamical and kinematical X-ray diffractions from silicon crystals with a triple crystal diffractometer / A. Iida, K. Kohra, A.V. Karpov, N.N. Faleev // Physica Status Solidi (A). – 1979. – Vol. 51. – P. 533–542.
- Kohn, V.G. Theory of imaging a perfect crystal under the conditions of X-ray spherical wave dynamical diffraction / V.G. Kohn, I. Snigireva, A. Snigirev, N.N. Faleev // Physica Status Solidi (B). – 2000. – Vol. 222. – P. 407–423.
- Stepanov, S. Fitting dynamical X-ray diffraction data over the World Wide Web / S. Stepanov, R. Forrest // J. Appl. Crystallogr. – 2008. – Vol. 41. – P. 958–962.
- Punegov, V.I. Vliyaniye defektov struktury na uglovoye raspredeleniye rentgenovskoy Laue-difraktsii v tonkom kristalle [Effect of structural defects on the angular distribution of x-ray Laue diffraction in a thin crystal] / V.I. Punegov, K.M. Pavlov // Pis'ma v ZhTF [Soviet technical physics letters]. – 1992. – Vol. 18. – № 6. – Р. 390–391.

Для цитирования:

Казаков, Д.В. Лауэ-дифракция рентгеновских пучков в многослойной структуре / Д.В. Казаков, В.И. Пунегов // Известия Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук. Серия «Физико-математические науки». – 2022. – № 5 (57). – С. 89–93. УДК: 539.231. DOI: 10.19110/1994-5655-2022-5-89-93

For citation:

Kazakov, D.V. Laue diffraction of X-ray beams in a multilayer structure / D.V. Kazakov, V.I. Punegov // Proceedings of the Komi Science Centre of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences. Series "Physical and Mathematical Sciences". – 2022. – № 5 (57). – P. 89–93. UDC: 539.231. DOI: 10.19110/1994-5655-2022-5-89-93

Дата поступления рукописи: 08.08.2022 Received: 08.08.2022